

微細化限界への挑戦: CMOS集積回路から量子ビットへ

参加無料

ZOOM

開催

講師: 水野 弘之 氏

(株式会社日立製作所 研究開発グループ 技師長 /2022年IEEE Fellow)

お申込みは こちらから→



2025年11月28日(金) 15:00~16:30

半導体集積回路技術は、その誕生以来、微細化を原動 力として性能向上と高集積化を実現してきた。しかし、 微細化の進展に伴い、短チャネル効果やサブスレッショ ルドリーク電流の増加、さらにはトランジスタのゲート絶 縁膜の薄膜化によるゲートリーク電流の増加など、物理 的限界が繰り返し指摘されてきた。これらの課題に対し、 材料面では高誘電率(High-k)絶縁膜の導入、構造面 ではFinFETやGAA(Gate-All-Around)構造など、 革新的な技術によって打開が図られてきた。さらに近 年では、同じ微細加工技術を応用し、単一電子の量子状 態を制御する半導体量子ドットを用いた量子ビット研究 が進展している。特にシリコン基板上の量子ドットは既 存CMOS技術との親和性が高く、大規模量子集積への 展開が期待されている。

本講演では、半導体微細化技術が物理限界を克服して きた歴史と、その延長線上にある量子情報デバイス開 発の最前線を概観する。



お問合せ:IEEE東京支部事務局 tokyosec@ieee-jp.org

主催/共催: IEEE 東京支部 TPC IEEE 東京支部 LMAG

IEICE 東京支部

協賛: